

2026-2032年中国计算光刻软件行业发展前景展望 及投资方向研究报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2026-2032年中国计算光刻软件行业发展前景展望及投资方向研究报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/software/1185334.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

《2026-2032年中国计算光刻软件行业发展前景展望及投资方向研究报告》由华经产业研究院研究团队精心研究编制，对计算光刻软件行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合计算光刻软件行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判；为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 计算光刻软件行业发展概述

第一节 计算光刻软件行业定义与分类

一、计算光刻软件行业概念界定

二、计算光刻软件行业分类体系

1、按工艺环节分类（光刻建模/邻近修正/掩模优化）

2、按算法路线分类（规则型/模型型/逆向型）

3、按部署方式分类（本地部署/私有云/公有云）

第二节 计算光刻软件行业发展历程

一、依托设计规则修正实现工艺补偿

二、模型化修正支撑先进制程量产

三、逆向光刻与全芯片仿真加速渗透

第三节 计算光刻软件行业商业模式分析

一、永久许可授权收取一次性费用

二、年度订阅按算力与节点计费

三、工艺协同项目按服务收费

第二章 中国计算光刻软件行业发展环境分析

第一节 中国计算光刻软件行业政策与法律环境分析

一、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》

二、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》

三、《国家集成电路产业发展推进纲要》

四、《“十四五”数字经济发展规划》

第二节 中国计算光刻软件行业经济与产业环境分析

一、晶圆厂扩产带动工艺软件采购上行

二、先进制程投资拉动仿真算力配套

第三节 中国计算光刻软件行业社会与需求环境分析

一、制程微缩使工艺协同需求上升

二、设计制造协同催生复合型人才需求

第四节 中国计算光刻软件行业技术与创新环境分析

一、混合超算架构提升全芯片求解效率

二、代理模型与逆向光刻融合加快落地

第五节 中国计算光刻软件行业SWOT分析

一、行业优势分析

1、国产工具在成熟制程具备快速适配能力

2、本土服务响应快且成本优势明显

二、行业劣势分析

1、先进节点模型精度与国际水平差距明显

2、全芯片求解算力与工程经验积累不足

三、行业机会分析

1、先进制程扩产带动工艺软件需求上行

2、出口管制加速国产工具验证与替换

四、行业威胁分析

1、海外厂商以生态捆绑压制国产替代

2、云厂商与设备商跨界进入分流需求

第六节 中国计算光刻软件行业进入壁垒分析

一、需长期产线数据积累与工艺验证

二、核心算法与求解器自研门槛高

三、与晶圆厂工艺绑定形成切换成本

四、全芯片仿真算力投入规模庞大

第七节 中国计算光刻软件行业退出壁垒分析

一、工艺模型与产线数据难以迁移

二、客户验证周期长致退出受阻

三、技术资产随团队流失而贬值

第三章 全球计算光刻软件行业发展现状分析

第一节 2021-2025年全球计算光刻软件市场需求分析

第二节 2021-2025年全球计算光刻软件市场规模分析

第三节 2021-2025年全球计算光刻软件价格走势分析

第四节 2021-2025年全球计算光刻软件价格因素分析

第五节 全球计算光刻软件行业区域分布格局

一、全球供给由少数厂商主导且集中度高

二、先进节点需求推动反向光刻加快渗透

三、云化订阅重塑工具交付与算力分工

第六节 全球计算光刻软件行业区域市场发展分析

一、亚太地区计算光刻软件行业现状与趋势预测

二、北美地区计算光刻软件行业现状与趋势预测

三、欧盟地区计算光刻软件行业现状与趋势预测

四、其他地区计算光刻软件行业现状与趋势预测

第七节 全球计算光刻软件行业重点区域动态分析

一、亚太地区发展动态

1、韩国存储大厂在先进节点扩大反向光刻

2、日本先进逻辑产线导入全芯片仿真平台

3、日本材料与设备厂商强化工艺协同验证

二、北美地区发展动态

1、美国收紧电子设计自动化工具对华出口

2、美国晶圆厂加快扩大反向光刻量产应用

3、美国设备商强化工艺模型与量测协同

三、欧盟地区发展动态

1、欧盟芯片法案带动制造与工艺软件投入

2、德国新建晶圆厂加快先进光刻工艺验证

第八节 全球计算光刻软件行业重点企业分析

一、新思科技

1、企业简介

2、企业经营态势分析

3、企业计算光刻软件业务发展概况

二、阿斯麦

1、企业简介

2、企业经营态势分析

3、企业计算光刻软件业务发展概况

第四章 中国计算光刻软件行业发展现状分析

第一节 中国计算光刻软件行业需求分析

一、计算光刻软件需求总量分析

二、计算光刻软件需求区域分布格局

第二节 中国计算光刻软件行业市场规模分析

一、计算光刻软件市场规模分析

二、计算光刻软件规模区域分布格局

第三节 2021-2025年中国计算光刻软件价格走势分析

第四节 2021-2025年中国计算光刻软件价格因素分析

第五章 计算光刻软件行业产业链分析

第一节 计算光刻软件行业产业链图谱分析

第二节 上游产业分析

一、高性能计算服务器与加速卡分析

1、2021-2025年高性能计算服务器与加速卡发展现状

2、2026-2032年高性能计算服务器与加速卡发展趋势

二、云超算与算力服务分析

1、2021-2025年云超算与算力服务发展现状

2、2026-2032年云超算与算力服务发展趋势

三、晶圆厂量测与工艺标定数据分析

1、2021-2025年晶圆厂量测与工艺标定数据发展现状

2、2026-2032年晶圆厂量测与工艺标定数据发展趋势

四、EDA几何引擎与数值算法库分析

1、2021-2025年EDA几何引擎与数值算法库发展现状

2、2026-2032年EDA几何引擎与数值算法库发展趋势

五、光刻成像模型与工艺参数分析

1、2021-2025年光刻成像模型与工艺参数发展现状

2、2026-2032年光刻成像模型与工艺参数发展趋势

第三节 下游产业分析

一、逻辑芯片制造分析

1、2021-2025年逻辑芯片制造发展现状

2、计算光刻软件在逻辑芯片制造的应用分析

3、2026-2032年逻辑芯片制造发展趋势

二、存储芯片制造分析

1、2021-2025年存储芯片制造发展现状

2、计算光刻软件在存储芯片制造的应用分析

3、2026-2032年存储芯片制造发展趋势

三、掩模版制造分析

1、2021-2025年掩模版制造发展现状

2、计算光刻软件在掩模版制造的应用分析

3、2026-2032年掩模版制造发展趋势

第四节 上下游产业链对计算光刻软件行业影响分析

第六章 中国计算光刻软件行业七大区域发展概况

第一节 华东地区计算光刻软件行业分析及预测

- 一、华东地区区位特征及经济概况
- 二、2021-2025年计算光刻软件市场规模分析
- 三、2026-2032年计算光刻软件市场前景预测

第二节 华北地区计算光刻软件行业分析及预测

- 一、华北地区区位特征及经济概况
- 二、2021-2025年计算光刻软件市场规模分析
- 三、2026-2032年计算光刻软件市场前景预测

第三节 东北地区计算光刻软件行业分析及预测

- 一、东北地区区位特征及经济概况
- 二、2021-2025年计算光刻软件市场规模分析
- 三、2026-2032年计算光刻软件市场前景预测

第四节 华中地区计算光刻软件行业分析及预测

- 一、华中地区区位特征及经济概况
- 二、2021-2025年计算光刻软件市场规模分析
- 三、2026-2032年计算光刻软件市场前景预测

第五节 华南地区计算光刻软件行业分析及预测

- 一、华南地区区位特征及经济概况
- 二、2021-2025年计算光刻软件市场规模分析
- 三、2026-2032年计算光刻软件市场前景预测

第六节 西南地区计算光刻软件行业分析及预测

- 一、西南地区区位特征及经济概况
- 二、2021-2025年计算光刻软件市场规模分析
- 三、2026-2032年计算光刻软件市场前景预测

第七节 西北地区计算光刻软件行业分析及预测

- 一、西北地区区位特征及经济概况
- 二、2021-2025年计算光刻软件市场规模分析
- 三、2026-2032年计算光刻软件市场前景预测

第七章 中国计算光刻软件行业市场竞争格局分析

第一节 中国计算光刻软件行业竞争主体与梯队格局

- 一、海外综合电子设计自动化集团主导
- 二、国产厂商聚焦单点工具差异化切入
- 三、晶圆厂自研团队构成隐性竞争者

第二节 中国计算光刻软件行业竞争格局与竞争特点

一、市场集中度高且头部厂商份额稳固

二、工具与工艺数据绑定形成使用黏性

三、国内份额偏低且国产化率处于末位

第三节 中国计算光刻软件行业竞争五力模型分析

一、现有竞争者之间的竞争强度分析

1、海外头部厂商占据主要产线份额

2、国产厂商在成熟制程展开价格竞争

二、潜在进入者威胁分析

1、晶圆厂自建团队形成纵向进入威胁

2、云厂商以算力平台切入工具服务

三、替代品威胁分析

1、晶圆厂自研修正流程替代部分采购

2、设备端集成工艺模型压缩软件空间

四、供应商议价能力分析

1、算力硬件供应受出口管制扰动明显

2、量测标定数据依赖晶圆厂开放程度

五、购买者议价能力分析

1、晶圆厂议价能力强且验证周期长

2、掩模厂需求集中且对精度要求高

第四节 中国计算光刻软件行业竞争成功要素分析

一、修正精度与收敛速度决定竞争力

二、与主流产线协同验证能力构成门槛

三、全芯片求解算力与算法效率并重

第五节 中国计算光刻软件行业替代品与进入者分析

一、开源几何库与自研脚本替代低端需求

二、设备商集成工艺模型削弱独立软件价值

三、通用仿真平台扩展功能侵蚀细分市场

第八章 中国计算光刻软件行业重点企业分析

第一节 东方晶源微电子科技（北京）股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业计算光刻软件业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第二节 全芯智造技术有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业计算光刻软件业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第三节 北京华大九天科技股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业计算光刻软件业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第四节 上海概伦电子股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业计算光刻软件业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第五节 杭州广立微电子股份有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业计算光刻软件业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第六节 深圳国微芯科技有限公司

一、企业简介

二、企业经营情况

三、企业计算光刻软件业务发展情况

四、企业技术水平分析

五、企业发展战略或动态分析

第九章 计算光刻软件行业趋势研判与策略建议

第一节 全球计算光刻软件行业发展趋势

一、全球计算光刻需求随制程微缩持续上行

二、全球供给格局向平台化整合加快演进

第二节 2026-2032年全球计算光刻软件发展趋势预测

一、2026-2032年全球计算光刻软件需求预测

二、2026-2032年全球计算光刻软件市场规模预测

三、2026-2032年全球计算光刻软件价格走势预测

第三节 中国计算光刻软件行业发展趋势研判

一、国产替代沿成熟制程向先进节点推进

- 1、国产软件由单点修正转向全链协同优化
- 2、成熟制程率先实现国产工具批量替换
- 3、产线验证周期压缩加快产品迭代节奏

二、算力架构升级重构全芯片仿真能力

- 1、混合超算架构支撑全芯片严格仿真求解
- 2、代理模型压缩仿真耗时并同步提升精度
- 3、云端弹性算力显著降低工艺验证门槛

三、工艺协同深化推动软件与制造绑定

- 1、软件厂商与晶圆厂联合共建工艺模型
- 2、设计与制造协同优化压缩工艺导入周期
- 3、良率管理需求牵引软件功能外延扩张

第四节 2026-2032年中国计算光刻软件发展趋势预测

一、2026-2032年中国计算光刻软件需求预测

二、2026-2032年中国计算光刻软件市场规模预测

三、2026-2032年中国计算光刻软件价格走势预测

第五节 中国计算光刻软件行业发展战略与建议

一、国产厂商以产线验证突破高端市场

- 1、国产厂商依托成熟产线验证积累口碑
- 2、以存储产线为切入点逐步拓展逻辑客户
- 3、联合晶圆厂共建工艺模型提升适配性

二、头部企业以云化订阅扩大用户覆盖

- 1、头部厂商以云化订阅加快降低使用门槛
- 2、按算力用量弹性计费扩大中小客户覆盖
- 3、开放工具接口加快嵌入晶圆厂工艺生态

第十章 中国计算光刻软件行业投资风险预警分析

第一节 政策风险预警

- 一、美国出口管制收紧影响工具授权
- 二、产业政策支持力度存在波动

第二节 市场风险预警

- 一、海外厂商降价挤压国产替代空间
- 二、先进节点需求波动影响订阅续费

第三节 技术风险预警

- 一、全芯片反向光刻算力需求增长过快
- 二、工艺模型精度不足制约先进节点应用

第四节 供应链风险预警

- 一、高端加速卡与算力资源供给受限
- 二、晶圆厂量测数据开放程度不足

第五节 经营风险预警

- 一、研发投入高企而收入确认周期长
- 二、客户集中度高导致订单波动明显

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/software/1185334.html>